

本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索

[打印本页] [关闭]

论文

沉积工艺和离子后处理对HfO₂薄膜残余应力的影响

肖祁陵

中国科学院上海光学精密机械研究所

摘要:

关键词:

Abstract:

Keywords:

收稿日期 2008-11-05 修回日期 2009-01-04 网络版发布日期 2008-12-30

DOI:

基金项目:

通讯作者: 肖祁陵

作者简介:

参考文献:

本刊中的类似文章

文章评论 (请注意: 本站实行文责自负, 请不要发表与学术无关的内容! 评论内容不代表本站观点.)

反馈人	<input type="text"/>	邮箱地址	<input type="text"/>
反馈标题	<input type="text"/>	验证码	<input type="text" value="6078"/>
反馈内容	<input type="text"/>		

扩展功能

本文信息

- ▶ Supporting info
- ▶ [PDF\(480KB\)](#)
- ▶ [HTML](#)
- ▶ 参考文献

服务与反馈

- ▶ 把本文推荐给朋友
- ▶ 加入我的书架
- ▶ 加入引用管理器
- ▶ 引用本文
- ▶ Email Alert
- ▶ 文章反馈
- ▶ 浏览反馈信息

本文关键词相关文章

本文作者相关文章

- ▶ 肖祁陵